1P002

佐賀 LS 軌道放射光を利用した環境半導体薄膜の電子状態研究 (熊本大・院自然¹,佐賀大・シンクロトロン²,岡山理科大・理³,茨城大・工⁴) 藤本 斉^{1,2},小川 浩二²,財部 健一³,鵜殿 治彦⁴,杉山 陽栄²,

東 純平²,高橋 和敏²,鎌田 雅夫²

序】

鉄ジシリサイド (FeSi₂)には,正方晶系の高温安定相 α と斜方晶系の低温安定相 β 及び立方晶系 の準安定相 γ の三種類が知られている。 α -FeSi₂は金属 [1], β -FeSi₂は0.83-0.89 eV のバンドギャップ をもつ半導体である [2]。存在量が豊富,かつ,リサイクルが可能で地球環境および人体に無害な元 素からなる半導体を環境半導体:Kankyo-Semiconductor (ecologically friendly semiconductor)」と 呼んでいる [3]が, β -FeSi₂はその代表的なものである。この β -FeSi₂薄膜で1.5 μ mの発光が報告され [4],また,吸収係数が大きいことから発光素子や太陽電池等への応用が期待でき,多くの研究がな されている。バンドギャップについての直接か間接かの議論もあり,多くの理論計算がなされている [5]。計算によると価電子帯,伝導帯ともにバンド端付近で Fe 3d 軌道に由来する大きな状態密度を もつとされている。価電子帯への Fe 及び Si の寄与を明らかにするために,Fe 3p 及び Si 2p 励起近 傍の光エネルギーによる価電子帯光電子スペクトルに注目した。

実験】

光電子分光測定は、九州シンクロトロン光研究センター(佐賀 LS)に設置した佐賀大学専用ビー ムライン BL13の平面回折格子分光器 (PGM)エンドステーションで行った。BL13-PGM エンドステー ションでは、光エネルギー範囲 2-150 eV の軌道放射光を利用できる。また、電子励起のオージェ電 子分光 (AES)もin situ で併せて行うことができる。

今回測定したβ-FeSi₂薄膜試料は、ガラス基板上のFeとSiを対向スパッタ法により洪蒸着したものである。 大気暴露後搬送し、BL13 において真空中 (base 圧 10⁻⁷ Pa)で表面清浄化のため Ar⁺イオン

スパッタをガスE 10⁻⁴ Pa,加速電圧 0.5 kV で4時間 行った。このスパッタ条件で,AES スペクトルに初期 状態で見られた表面汚染及び酸化膜由来の C,N, O のピークはほぼ消失したが,スパッタに用いた Ar が試料薄膜中に若干残留した。この残留 Ar は 250 の加熱でも除去できなかったため,Ar が残留 した状態で光電子分光測定を行った。

結果と考察】

励起光エネルギーhv = 120,130 及び 140 eV に おける光電子スペクトルを図 1 に示す。光電子の運 動エネルギーが 44 及び 88 eV にそれぞれ Fe の $M_{23}VV$ 及び Si の $L_{23}VV$ オージェ電子によるピークが 観測された。また,Fe 3p 及び Si 2p の結合エネルギ ーをそれぞれ 53 eV 及び 99 eV ど決定した。

図 2 に Fe 3p 励起端付近の励起光エネルギーに よる価電子帯の光電子スペクトルを示す。挿入図は, hv = 54 eV のスペクトルから48 eV のスペクトルを差 し引いた差スペクトルである。この光エネルギー領域 において Siのイオン化断面積はほとんど変化しない ので,差スペクトルは Fe の主に 3d 軌道の価電子帯 への寄与を表していると考えられる。差スペクトルは,



図 1. β-FeSi₂ 薄膜の光電子スペクトル

最近の密度汎関数法による第一原理バンド計算から 得られた Fe 3d 部分状態密度 [6] とバンド幅 (約 2 eV) 及び結合エネルギー2 eV の構造などよく一致する。こ の励起光領域では、負の共鳴が見られるが、これは価 電子帯では Fe とSi との間に金属 - 配位子間電荷移 動 [7]が起きていることを示唆している。従って、 β-FeSi₂の価電子帯は、Fe 3d の寄与が大きいものの、 Si 3s 及び 3p の寄与もあるものと考えられる。

一方,価電子帯の光電子スペクトルをSi2p励起が 起こる前の励起光エネルギーにより測定すると図 3 に 示すようこhv = 95 eV 付近でスペクトルに変化が見ら れた。hv > 94 eV の領域では光電子の運動エネルギ ーが約 90 eV と一定で励起光エネルギーに依存しな いオージェピークが観測された。Si 2pの結合エネルギ ーは 99 eV であるから、この励起光エネルギーでは Si 2 p励起は起こらない、従って,結合エネルギーが 91 eV 付近 [8]にある Fe 3 s励起に伴うFe M1VV オージェ 光電子によるピークと帰属できる。この Fe M₁VV オー ジェピークの半値幅は約2eVとバンド計算のFe3d部 分状態密度のバンド幅 [6]と一致して細く,形状も Si L23 VV オージェピークと異なる (図 3 挿入図)。 このこと は理論計算が予測しているように価電子帯上端に Fe 3d 軌道の寄与が大きい狭いバンドが存在していること を示している。

謝辞】

本研究は、九州地区ナノテクノロジー拠点ネットワーク シンクロトロン放射光を用いた材料分野におけるナ /計測・分析支援」の協力研究として行われました。関 係各位に感謝申し上げます。

惨考文献】

- D. Shinoda and S. Asanabe, J. Phys. Soc. Jpn., 21, 555 (1966).
- [2] Lange, *Phys. Stat. Solid.* (*b*), **201**, 3 (1997) and references therein.
- [3]Y. Makita, in Proceedings of the Japan-UK Joint Workshop on Kankyo-Semiconductors (Ecologically Friendly Semiconductors), edited by Y. Makita (Society of Kankyo Semiconductors in Japan, Japan, 1999), p. 1.
- [4] D. Loong, M. Harry, K.J. Reeson, and K.P. Homewood, *Nature*, **387**, 688 (1997).
- [5]S.J. Clark, H.M. Al-Allak, S. Brand, and R.A. Abran, *Phys. Rev. B*, **58**, 10389 (1998) and references therein.
- [6]Z.J. Pan, L.T. Zhang, and J.S. Wu, *Mater. Sci. Eng. B*, **131**, 121 (2006).
- [7] R.J. Lad and V.E. Henrich, *Phys. Rev. B*, **39**, 13478 (1989) and references therein.
- [8] F.U. Hillebrecht, T. Kinoshita, Ch. Roth, H.B. Rose, and E. Kisker, J. Mag. Mag. Mater., 212, 201 (2000).



図 2. β-FeSi2薄膜の Fe 3p 励起端近傍の励 起光による光電子スペク Hレ 挿入図 は hv = 54 eV と48 eVの差スペク Hレ)



図 3. β-FeSi₂薄膜の Si 2p 励起端以前の励 起光による光電子スペク Hレ 挿入図 は Fe *M*₁VV とSi *L*₂₃VV ピークの比較 〕